

産業標準案作成対象テーマの審議について

日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS 案作成規程に基づき、当該 JIS 案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事務局による“JIS 案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会にお諮りすることとなっております。

つきましては、次ページ以降の JIS 案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待効果、JIS 案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS 案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の下に JIS 素案の調査審議及び作成を行うための WG を設置することについても併せてご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	01 基本	改正	B0661	製品の幾何特性仕様(GPS)マトリックスモデル(追補)	Geometrical product specifications (GPS) – Matrix model (Amendment 1)	この規格は、「製品の幾何特性仕様(GPS)」規格体系の概要及び構造を規定し、表の形で提供するものであり、全てのGPS規格群は、この規格に規定されたマトリックスモデル(表)を附属書にもち、GPS規格の位置づけを明示するよう整理されている。 GPSに関する多くのJISでは、“surface imperfection”と“surface defect”のいずれにも、“表面欠陥”を日本語訳として適用している。この“表面欠陥”を日本語訳として適用すると、“surface imperfection”と“surface defect”が並記されている国際規格の日本語文章の意味が不明となる。また、“欠陥”は製造物責任法(PL法)において“当然有すべき安全性を欠いていること”とされており、リコールの対象となるものであるため、非常にネガティブな印象を与える語句となっている。一方、Surface imperfectionは機能と関係するかどうかを問わないものであり、この観点から“表面欠陥”という呼び方は避ける必要がある。そのため、“surface imperfection”と“surface defect”の定義を確認し、それぞれの用語に適切な日本語訳を適用することが必要との問題提起がなされ、ISO/TC213国内委員会で用語の調査及び定義の整理、議論を行った結果、“surface imperfection”を“表面不整”、“surface defect”を“表面欠陥”と整理することで合意された。こうしたことから、幾何特性として特定されている区分のうち、対応国際規格での“surface imperfection”に対応して“表面欠陥”と規定している用語を、“表面不整”と改めるための改正を行う必要がある。	この改正によって、対応国際規格との整合がより明確になるとともに、最近の技術の実態に即した幾何特性の区分となるため、相互理解の促進、効率的な産業活動の推進などにより一層寄与することが期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 GPS規格体系で特定されている幾何特性のうち、対応国際規格 ISO 14638:2015での“surface imperfection”に対応して規定している“表面欠陥”を、表面不整”に改める。	—	ISO 14638:2015	IDT	第2条の該当号: 2(設計方法、製図方法) 対象事項: 鋳工業品	法律の目的に適合している。	利点: ウ 欠点: いずれも該当しない。	基礎的・基盤的分野		一般財団法人日本規格協会のWG	2022年10月
JSA	01 基本	改正	Z8617-5	ダイヤグラム用図記号—第5部:計測及び制御装置(追補)	Graphical symbols for diagrams—Part 5: Measurement and control devices (Amendment 1)	JIS Z 8617規格群は、全産業分野のダイヤグラム用図記号を網羅することを意図し、対応国際規格であるISO 14617規格群との一致規格として制定されており、JIS Z 8617-3～JIS Z 8617-14において、各装置・機器に応じたダイヤグラム用図記号を規定している。これらの規格とは別に、真空装置用の図記号を規定する規格として、JIS Z 8207が制定されており、その一部がJIS Z 8617規格群に取り込まれている。しかし、近年、真空技術は、半導体・電子部品、自動車、化学、機械、光学、材料、建設、食品・バイオ、エネルギー、航空・宇宙など、幅広い産業分野で利用されていることから、JIS Z 8207に規定する図記号をJIS Z 8617規格群の相当するパートに取り込むことで充実を図るとともに、JIS Z 8207を廃止し、一元化することが求められている。 なお、現在、ISO 14617規格群については、我が国がプロジェクトリーダーを務め、改訂作業が進められており、近年使用頻度が高い真空装置の図記号を追加する予定であり、JIS Z 8617規格群とISO 14617規格群との見直しを並行して進めることで、国際整合性も確保される。 こうしたことから、計測及び制御装置のダイヤグラム用図記号を規定するこの規格(第5部)において、JIS Z 8207に規定する真空計の図記号を追加するための改正が必要である。	この改正によって、真空装置の生産者と使用者の間で正確な情報の伝達が可能になり、商取引の円滑化や相互理解の促進が期待される。なお、真空装置の生産者として、(一社)日本真空工業会があり、2021年の売上高は約5450億円である。また、真空装置の代表的な使用者として、(一社)半導体製造装置協会があり、半導体製造装置の2021年の売上高は国内で約8000億円、全世界で約10兆円である。	主な改正点は、次のとおり。 1) JIS Z 8207 真空装置用図記号で規定されている真空計[隔膜真空計、ブルドン管真空計、熱伝導真空計(ピラー真空計)、熱陰極電離真空計、分圧真空計など)の図記号の追加。 2) 近年、日本国内で使用されている真空計(スピニングロータ真空計、水晶摩擦真空計、エキストラクター真空計、気体質量流量計(マスフローメータ)など)の図記号の追加。	—	ISO 14617-5:2002	MOD	第2条の該当号: 5(記号) 対象事項: 計測及び制御装置のダイヤグラム	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	基礎的・基盤的な分野		一般財団法人日本規格協会のWG	2022年10月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	01 基本	改正	Z8617-8	ダイアグラム用図記号—第8部:バルブ及びダンパ(追補)	Graphical symbols for diagrams—Part 8: Valves and dampers (Amendment 1)	JIS Z 8617規格群は、全産業分野のダイアグラム用図記号を網羅することを意図し、対応国際規格であるISO 14617規格群との一致規格として制定されており、JIS Z 8617-3～JIS Z 8617-14において、各装置・機器に応じたダイアグラム用図記号を規定している。これらの規格とは別に、真空装置用の図記号を規定する規格として、JIS Z 8207が制定されており、その一部がJIS Z 8617規格群に取り込まれている。しかし、近年、真空技術は、半導体・電子部品、自動車、化学、機械、光学、材料、建設、食品・バイオ、エネルギー、航空・宇宙など、幅広い産業分野で利用されていることから、JIS Z 8207に規定する図記号をJIS Z 8617規格群の相当するパートに取り込むことで充実を図るとともに、JIS Z 8207を廃止し、一元化することが求められている。 なお、現在、ISO 14617規格群については、我が国がプロジェクトリーダを務め、改訂作業が進められており、近年使用頻度が高い真空装置の図記号を追加する予定であり、JIS Z 8617規格群とISO 14617規格群との見直しを並行して進めることで、国際整合性も確保される。 こうしたことから、汎用バルブ、流体機械装置、食品、製薬などに用いるバルブ及びダンパのダイアグラム用図記号を規定するこの規格(第8部)において、JIS Z 8207に規定する真空バルブの図記号を追加するための改正が必要である。	この改正によって、真空装置の生産者と使用者の間で正確な情報の伝達が可能になり、商取引の円滑化や相互理解の促進が期待される。なお、真空装置の生産者として、(一社)日本真空工業会があり、2021年の売上高は約5450億円である。また、真空装置の代表的な使用者として、(一社)半導体製造装置協会があり、半導体製造装置の2021年の売上高は国内で約8000億円、全世界で約10兆円である。	主な改正点は、次のとおり。 1) JIS Z 8207 真空装置用図記号で規定されている2つの真空バルブの(空気圧式アクチュエータ付き双方弁、手動止め弁)図記号の追加。 2) 近年、日本国内で使用されている真空装置への気体導入器(マスフローコントローラ)の図記号の追加。	—	ISO 14617-8:2002	MOD	第2条の該当号: 5(記号) 対象事項: バルブ及びダンパのダイアグラム	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	基礎的・基盤的な分野		一般財団法人日本規格協会のWG	2022年10月
JSA	01 基本	改正	Z8617-9	ダイアグラム用図記号—第9部:ポンプ、コンプレッサ及びファン(追補)	Graphical symbols for diagrams—Part 9: Pumps, compressors and fans (Amendment 1)	JIS Z 8617規格群は、全産業分野のダイアグラム用図記号を網羅することを意図し、対応国際規格であるISO 14617規格群との一致規格として制定されており、JIS Z 8617-3～JIS Z 8617-14において、各装置・機器に応じたダイアグラム用図記号を規定している。これらの規格とは別に、真空装置用の図記号を規定する規格として、JIS Z 8207が制定されており、その一部がJIS Z 8617規格群に取り込まれている。しかし、近年、真空技術は、半導体・電子部品、自動車、化学、機械、光学、材料、建設、食品・バイオ、エネルギー、航空・宇宙など、幅広い産業分野で利用されていることから、JIS Z 8207に規定する図記号をJIS Z 8617規格群の相当するパートに取り込むことで充実を図るとともに、JIS Z 8207を廃止し、一元化することが求められている。 なお、現在、ISO 14617規格群については、我が国がプロジェクトリーダを務め、改訂作業が進められており、近年使用頻度が高い真空装置の図記号を追加する予定であり、JIS Z 8617規格群とISO 14617規格群との見直しを並行して進めることで、国際整合性も確保される。 こうしたことから、主として輸送用のポンプ、コンプレッサ及びファンに用いるダイアグラム用図記号を規定するこの規格(第9部)において、JIS Z 8207に規定する真空ポンプの図記号を追加するための改正が必要である。	この改正によって、真空装置の生産者と使用者の間で正確な情報の伝達が可能になり、商取引の円滑化や相互理解の促進が期待される。なお、真空装置の生産者として、(一社)日本真空工業会があり、2021年の売上高は約5450億円である。また、真空装置の代表的な使用者として、(一社)半導体製造装置協会があり、半導体製造装置の2021年の売上高は国内で約8000億円、全世界で約10兆円である。	主な改正点は、次のとおり。 1) JIS Z 8207 真空装置用図記号で規定されている真空ポンプ(液封真空ポンプ、ドライ真空ポンプ、メカニカルブースター真空ポンプ、ダイヤフラム真空ポンプ、スパッタイオン真空ポンプ、サブリーション真空ポンプなど。)の図記号の追加。 2) 近年、日本国内で使用されている真空ポンプ(ターボ分子ポンプ、ルーツポンプ、非蒸発ゲッタ真空ポンプなど。)の図記号の追加。	—	ISO 14617-9:2002	MOD	第2条の該当号: 5(記号) 対象事項: ポンプ、コンプレッサ及びファンのダイアグラム	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	基礎的・基盤的な分野		一般財団法人日本規格協会のWG	2022年10月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	01 基本	改正	Z8617-12	ダイアグラム用図記号—第12部:分離、清浄及び混合用の装置(追補)	Graphical symbols for diagrams — Part 12 : Devices for separating, purification and mixing (Amendment 1)	JIS Z 8617規格群は、全産業分野のダイアグラム用図記号を網羅することを意図し、対応国際規格であるISO 14617規格群との一致規格として制定されており、JIS Z 8617-3～JIS Z 8617-14において、各装置・機器に応じたダイアグラム用図記号を規定している。これらの規格とは別に、真空装置用の図記号を規定する規格として、JIS Z 8207が制定されており、その一部がJIS Z 8617規格群に取り込まれている。しかし、近年、真空技術は、半導体・電子部品、自動車、化学、機械、光学、材料、建設、食品・バイオ、エネルギー、航空・宇宙など、幅広い産業分野で利用されていることから、JIS Z 8207に規定する図記号をJIS Z 8617規格群の相当するパートに取り込むことで充実を図るとともに、JIS Z 8207を廃止し、一元化することが求められている。 なお、現在、ISO 14617規格群については、我が国がプロジェクトリーダーを務め、改訂作業が進められており、近年使用頻度が高い真空装置の図記号を追加する予定であり、JIS Z 8617規格群とISO 14617規格群との見直しを並行して進めることで、国際整合性も確保される。 こうしたことから、分離、清浄及び混合用の装置のダイアグラム用図記号を規定するこの規格(第12部)において、JIS Z 8207に規定する同装置に関わる真空機器の図記号を追加するための改正が必要である。	この改正によって、真空装置の生産者と使用者の間で正確な情報の伝達が可能になり、商取引の円滑化や相互理解の促進が期待される。なお、真空装置の生産者として、(一社)日本真空工業会があり、2021年の売上高は約450億円である。また、真空装置の代表的な使用者として、(一社)半導体製造装置協会があり、半導体製造装置の2021年の売上高は国内で約8000億円、全世界で約10兆円である。	主な改正点は、次のとおり。 1) JIS Z 8207 真空装置用図記号 で規定されている分離、清浄及び混合用の装置(バップル、冷却バップル、トラップ、冷却トラップ)の図記号の追加。	—	ISO 14617-12:2002	MOD	第2条の該当号: 5(記号) 対象事項: 分離、清浄及び混合用の装置のダイアグラム	法律の目的に適合している。	利点: ウ、オ 欠点: いずれも該当しない。	基礎的・基盤的な分野		一般財団法人日本規格協会のWG	2022年10月